

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成18年4月6日(2006.4.6)

【公開番号】特開2000-17021(P2000-17021A)

【公開日】平成12年1月18日(2000.1.18)

【出願番号】特願平11-64663

【国際特許分類】

C 08 F 212/08	(2006.01)
B 60 C 1/00	(2006.01)
C 08 F 2/00	(2006.01)
C 08 F 2/22	(2006.01)
C 08 L 9/06	(2006.01)
C 08 F 236/06	(2006.01)

【F I】

C 08 F 212/08	
B 60 C 1/00	A
C 08 F 2/00	A
C 08 F 2/22	
C 08 L 9/06	
C 08 F 212/08	
C 08 F 236/06	

【手続補正書】

【提出日】平成18年2月21日(2006.2.21)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】スチレン及び1,3-ブタジエンから誘導される繰り返し単位を含んで成るスチレン-ブタジエンゴム組成物であって、該スチレン-ブタジエンゴム組成物は熱フィールドフロー分別によって決定される約50000~15000の範囲内の数平均分子量を有し、そしてスチレン-ブタジエンゴムが1.8~3.9の範囲内である、光散乱の屈折率に対する比を有する、前記のスチレン-ブタジエンゴム組成物。

【請求項2】ラテックス組成物を凝固させることを含む方法によって製造されるスチレン-ブタジエンゴム組成物であって、該ラテックス組成物が、(a)水、(b)乳化剤、(c)少なくとも約30000の重量平均分子量を有する高分子量スチレン-ブタジエンゴム、及び(d)約28000未満の重量平均分子量を有する低分子量スチレン-ブタジエンゴムを含んで成り、高分子量スチレン-ブタジエンゴムの低分子量スチレン-ブタジエンゴムに対する比が約80:20~約25:75の範囲内であり、そして高分子量スチレン-ブタジエンゴムの結合スチレン含量が低分子量スチレン-ブタジエンゴムの結合スチレン-ブタジエンゴムと少なくとも10%ポイント異なる、前記のスチレン-ブタジエンゴム組成物。

【請求項3】外周トレッド、2つの間隔を開けたビード、少なくとも1つの、ビードからビードへ伸びるプライ、前記トレッドから半径方向に伸びかつ前記トレッドを前記ビードに連結している複数のサイドウォールを有する一般にトロイド状に付形されたカーカスを含むタイヤであって、前記トレッドは地面に接触するよう適合されており、トレッドが、請求項1に記載のスチレン-ブタジエンゴム組成物を含んで成る、前記のタイヤ。